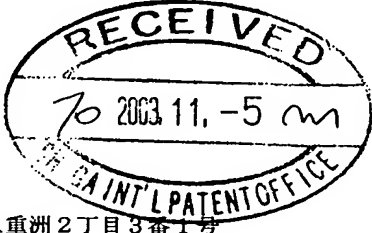


Rec'd PCT/PTC 03 SEP 2004

特許協力条約

発信人 日本国特許庁 (国際予備審査機関)

出願人代理人 志賀 正武 あて名 〒 104-8453 東京都中央区八重洲2丁目3番1号 志賀国際特許事務所	
---	---

PCT見解書

(法第13条)
[PCT規則66]

03.12.21

出願人又は代理人 の書類記号 PC-8745	発送日 (日.月.年) 04.11.03
国際出願番号 PCT/JP03/02568	国際出願日 (日.月.年) 05.03.03
優先日 (日.月.年) 05.03.02	応答期間 上記発送日から 2 月以内
国際特許分類 (IPC) Int. Cl ⁷ H01L21/322	
出願人 (氏名又は名称) 三菱住友シリコン株式会社	

1. これは、この国際予備審査機関が作成した 1 回目の見解書である。
2. この見解書は、次の内容を含む。 I <input checked="" type="checkbox"/> 見解の基礎 II <input type="checkbox"/> 優先権 III <input type="checkbox"/> 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成 IV <input type="checkbox"/> 発明の単一性の欠如 V <input checked="" type="checkbox"/> 法第13条 (PCT規則66.2(a)(ii)) に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 VI <input type="checkbox"/> ある種の引用文献 VII <input type="checkbox"/> 国際出願の不備 VIII <input type="checkbox"/> 国際出願に対する意見
3. 出願人は、この見解書に応答することが求められる。 いつ? 上記応答期間を参照すること。この応答期間に間に合わないときは、出願人は、法第13条 (PCT規則66.2(d)) に規定するとおり、その期間の経過前に国際予備審査機関に期間延長を請求することができる。ただし、期間延長が認められるのは合理的な理由があり、かつスケジュールに余裕がある場合に限られることに注意されたい。 どのように? 法第13条 (PCT規則66.3) の規定に従い、答弁書及び必要な場合には、補正書を提出する。補正書の様式及び言語については、法施行規則第62条 (PCT規則66.8及び66.9) を参照すること。 なお 補正書を提出する追加の機会については、法施行規則第61条の2 (PCT規則66.4) を参照すること。補正書及び/又は答弁書の審査官による考慮については、PCT規則66.4の2を参照すること。審査官との非公式の連絡については、PCT規則66.6を参照すること。 応答がないときは、国際予備審査報告は、この見解書に基づき作成される。
4. 国際予備審査報告作成の最終期限は、PCT規則69.2の規定により 05.07.04 である。

名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/J P) 郵便番号 100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 萩原 周治 電話番号 03-3581-1101 内線 9835	4 L 9835
--	--	----------

I. 見解の基礎

1. この見解書は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この見解書において「出願時」とする。)

☐ 出願時の国際出願書類

☒ 明細書 第 1-14 ページ、 出願時に提出されたもの
明細書 第 _____ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
明細書 第 _____ ページ、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの

☒ 請求の範囲 第 3-6 項、 出願時に提出されたもの
請求の範囲 第 1 項、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの
請求の範囲 第 _____ 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
請求の範囲 第 _____ 項、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの

☒ 図面 第 1-8 ~~ページ~~/図、 出願時に提出されたもの
図面 第 _____ ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
図面 第 _____ ページ/図、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの

☐ 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 出願時に提出されたもの
明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である _____ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき見解書を作成した。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表
☐ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった
☐ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

☐ 明細書 第 _____ ページ
☒ 請求の範囲 第 2 項
☐ 図面 図面の第 _____ ページ/図

5. ☐ この見解書は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第13条（PCT規則66.2(a)(ii)に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	3, 4	有
	請求の範囲	1, 5, 6	無
進歩性 (IS)	請求の範囲		有
	請求の範囲	1-6	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-6	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明

文献1: US 5502010 A (KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA), 1996. 03. 26

文献2: EP 973190 A2 (SHIN-ETSU HANDOTAI COMPANY LIMITED), 2000. 01. 19

文献3: JP 2001-44207 A (三菱マテリアルシリコン株式会社), 2001. 02. 16

請求の範囲1, 6に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1, 2により、新規性、進歩性を有さない。

文献1（第6欄第4行乃至第45行及び第4図）には、シリコン単結晶層に900℃で240秒以下の熱処理を施すことが教示されている。

請求の範囲1, 6に係る発明は、国際調査報告で引用された文献2により、新規性、進歩性を有さない。

文献2（段落[0030] - [0032]）には、シリコン単結晶層に900℃以上で1-300秒の熱処理を施すことが教示されている。

請求の範囲3-5に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1-3により、進歩性を有さない。

文献3（段落【0005】，【0018】 - 【0019】）には、パーフェクト領域[P]からなるインゴットから切り出された点欠陥の凝集体が存在しない基板に、研削研磨を施した後、酸素析出核を導入するための熱処理を施すことが教示されている。

文献1, 2教示の発明において、文献3に教示されているように、基板として、パーフェクト領域[P]からなるインゴットから切り出された点欠陥の凝集体が存在しない基板を用い、熱処理前に研磨処理を行うようにすることは、当業者にとって容易である。

